

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-255319  
 (43)Date of publication of application : 25.09.1998

(51)Int.Cl. G11B 7/135  
 G03F 7/20

(21)Application number : 09-076450  
 (22)Date of filing : 12.03.1997

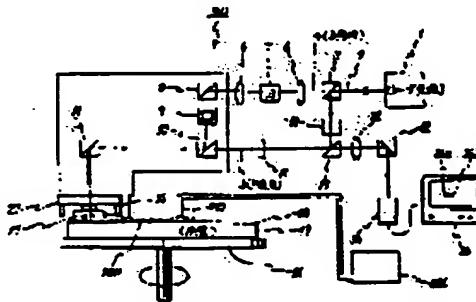
(71)Applicant : HITACHI MAXELL LTD  
 (72)Inventor : SUENAGA MASASHI  
 SUGIYAMA TOSHINORI

## (54) MASTER DISK EXPOSURE DEVICE AND METHOD THEREFOR

## (57)Abstract

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a master disk exposure device capable of exposing a minute pit and a narrow groove with high precision and provided with a developing function.

SOLUTION: In this master disk exposure device 100, a master disk 19 coated with a photoresist film 20 is irradiated convergently with laser beams to form a desired pattern. A nozzle 210 fills water between a condensing lens 17 and the master disk 19 during the exposure. The condensing lens 17 increases in NA and functions as an immersion objective. With the nozzle arranged in piping for a water tank and a developer tank, and with a valve installed that changes a feeding liquid to water or developer, the master disk aligner can also be used as a developing device.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2000 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-255319

(43)公開日 平成10年(1998)9月25日

(51)Int.Cl'

G 11 B 7/135  
G 03 F 7/20

識別記号

505

P 1

G 11 B 7/135  
G 03 F 7/20

Z  
505

審査請求 未請求 請求項の数9 FD (全9頁)

(21)出願番号

特願平9-76450

(22)出願日

平成9年(1997)3月12日

(71)出願人 000005810

日立マクセル株式会社  
大阪府茨木市立東1丁目1番88号

(72)発明者 来水 正志

大阪府茨木市立東1丁目1番88号 日立マ  
クセル株式会社内

(72)発明者 杉山 勝紀

大阪府茨木市立東1丁目1番88号 日立マ  
クセル株式会社内

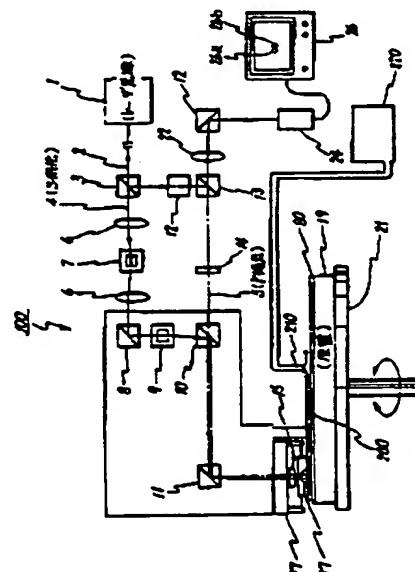
(74)代理人 弁理士 川北 喜十郎 (外1名)

(54)【発明の名称】 原盤露光装置及び方法

(57)【要約】

【課題】 微小ピット及び幅狭縫を高精度で露光するこ  
とができる、しかも現像液槽をも同時に備えた原盤露光装  
置を提供する。

【解決手段】 原盤露光装置100はフィトレジスト膜  
20を塗布した原盤19にレーザ光を聚焦して照射して  
所望のパターンに露光する。ノズル210は露光中に集  
光レンズ17と原盤19との間に水を充満させる。集光  
レンズ17のNAが増大し、液浸レンズとして機能す  
る。該ノズルを水タンク及び現像液タンクに配管し、供  
給液体を水または現像液に切り換えるバルブを備えるこ  
とにより、原盤露光装置を現像装置としても機能させ  
ることもできる。



(2)

特開平10-255319

2

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 フォトレジストを塗布した記録媒体製造用原盤にレーザ光を集光して照射することによりフォトレジストを所望のパターンに曝光する原盤露光装置において。

上記レーザ光を上記原盤表面に集光するための光学素子と。

上記光学素子と上記原盤表面との間の光路に液体を介在させるための手段とを備えることを特徴とする原盤露光装置。

【請求項2】 上記光学素子が液浸レンズとして構成することを特徴とする請求項1記載の原盤露光装置。

【請求項3】 上記液体を介在させるための手段が、原盤上に液体を吐出するためのノズルと、該ノズルに液体を供給するための液体供給装置とから構成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の原盤露光装置。

【請求項4】 さらに、現像液を原盤上に供給するための手段を有することを特徴とする請求項1～3のいずれか一項に記載の原盤露光装置。

【請求項5】 上記現像液を原盤上に供給するための手段が、上記原盤上に上記液体または現像液を吐出するためのノズルと、該ノズルに上記液体または現像液を供給するための供給装置と、該ノズルへの上記液体または現像液の供給を切り換えるための切り替え装置とから構成されていることを特徴とする請求項4に記載の原盤露光装置。

【請求項6】 さらに、露光及び現像された原盤を検査するための検査装置を備えることを特徴とする請求項5に記載の原盤露光装置。

【請求項7】 上記検査装置が、原盤露光装置の上記光学素子を含む光ヘッドであることを特徴とする請求項6に記載の原盤露光装置。

【請求項8】 上記液体が水であることを特徴とする請求項1～7のいずれか一項記載の原盤露光装置。

【請求項9】 フォトレジストを塗布した記録媒体製造用原盤にレーザ光を集光して照射することによりフォトレジストを所望のパターンに曝光する原盤露光方法において。

上記レーザ光を集光するための光学素子と原盤との間に液体を介在させながら原盤露光を行うことを特徴とする原盤露光方法。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、光ディスク等の記録媒体用基板の原盤を製造するための原盤露光装置に関するものである。また、本発明は、記録媒体用基板の原盤を製造するための原盤露光装置に関するものである。

## 【0002】

【従来の技術】 コンパクトディスクや光記憶ディスクの基板は、プリフォーマット信号に対応するグループやブリエンボスピットのパターンを原盤上に露光及び現像により形成した後、得られた原盤を複数してスタンバを作製し、スタンバを基板した射出成型器でプラスチック材料等を射出成型することによって製造される。原盤にグループやブリエンボスピットのパターンを形成するためには露光装置が用いられている。露光装置は、通常、フォトレジストが塗布されたガラス原盤を回転しながら、原盤面に照射するレーザ光をプリフォーマット信号に応じてオンオフすることによって所定のパターンでフォトレジストを露光する。露光した原盤は、露光装置から取り外された後、現像装置のターンテーブルに装着され、回転している原盤表面に上方からアルカリ液を供給することにより現像が行われる。現像が終わると、原盤に形成された溝やピットの寸法が適切かどうかを光ヘッドを備えた検査装置により検査される。こうしてスタンバ形成用の原盤が作製されている。

【0003】 上述の原盤露光装置として、例えば、テレビジョン学会誌 Vol.37, No.6, 475-490頁(1983年)には、レーザ光波長λ = 457.98 nm、レンズ開口数NA = 0.93の光ヘッドを用いて、原盤上にスポットサイズ約0.5 μmにレーザ光を絞り込むことができるVHD/AHD方式ビデオディスクのレーザカッティングマシンが開示されている。このカッティングマシンを用いると最小0.25 μmのエンボスピットを形成することができる事が報告されている。また、このカッティングマシンはレーザスポットを原盤に追従させるためにHe-Neレーザを補助ビームとしたフォーカシングサーボ系を用いている。

【0004】 特開平6-187668号公報は、映トラックピッチャ化、高密度記録しても映像トラックからのクロストークを軽減することができる光ディスク原盤の製造方法を開示しており、原盤露光において上記文献とはほぼ同じ構成のレーザカッティングマシンを使用している。

## 【0005】

【発明が解決しようとする課題】 近年のマルチメディア化による情報量の増大に伴い、光ディスク等の情報記録媒体の高密度化、大容量化が要望されている。この要望に応えるために、原盤露光装置においても光ディスク等に記録するエンボスピットやグループのパターンをより微小化して露光する必要がある。かかる微小パターンを露光するには、レーザ光を原盤に集光するレンズの開口数(NA)を増大すること、レーザ光の波長を短波長化することが考えられる。しかしながら、レンズのNA及びレーザ波長の短波長化には限界があり、露光分解能を大幅に向上することは容易ではない。

【0006】 また、前記のように露光及び現像工程は、それぞれ、原盤露光装置及び現像装置を用いて別々に行

(3)

节阻平10-255319

3

われていたため、製造コストがかかるとともに、製造設  
置スペースも必要であり、さらにスタンバを製造するま  
での工程を複雑化していた。

【0007】本発明の目的は、情報ビットの最小化及び  
状トラックピッチ化に対応した狭縫化を実現するこ  
とができる原盤基光装置を提供することにある。

【0008】また、本発明の別の目的は、高光輝度のみならず現像機能をも備え且つ高光解像力が向上した原盤露光装置を提供することにある。

【0009】本発明のさらに別の目的は、情報ビットの微小化及び狭トラックビッチ化に対応した狭溝化を実現することができる原盤露光方法を提供することにある。

【課題を解決するための手段】本発明の第1の態様に從えば、フォトレジストを塗布した記録媒体製造用原盤にレーザ光を集光して照射することによりフォトレジストを所望のパターンに曝光する原盤露光装置において、上記レーザ光を上記原盤表面に集光するための光学素子と、上記光学素子と上記原盤表面との間の光路に液体を介在させるための手段とを備えることを特徴とする原盤

【0010】本発明の原盤露光装置の原理を図6を用いて説明する。図6は、本発明の原盤露光装置の光ヘッドにより露光されている原盤19近傍の拡大概念図である。原盤露光装置のレーザ光源(図示しない)から照射されたレーザ光4はリレーレンズ15を介して集光レンズ17により原盤上に塗布されたフォトレジスト膜20の表面に集光される。本発明の原盤露光装置は、図6に示したように液体200を原盤表面上に供給するノズル210を備えており、露光動作中には、このノズル210から供給された液体200により原盤のフォトレジスト膜20と集光レンズ17との間隙は充満される。ここで、集光レンズ17により勘別しうる2点間の最小距離 $r$ は一般に下記式(1)により表される。

(0011)

〔数1〕

$$r = \lambda / NA = \lambda / (n \cdot s \cdot n \sigma) \quad \dots \quad (1)$$

式中、 $\alpha$ は集光レンズ17に入射するレーザ光4の波長、NAは集光レンズ17の開口数、nは集光レンズ17の物点割（原点割）媒質の屈折率、 $\alpha$ は集光レンズ17から照射される光束の最大開きの半分すなわち開口半角をそれぞれ示す。集光レンズ17により識別しうる2点間の最小距離 $r$ が小さいほど、原点電光装置の電光解像力が高いといえる。レーザ光の波長入を一定とした場合、 $r$ を小さくするには上式（1）からNAを大きくすればよいことがわかる。NAは式（1）のように $NA = n \cdot \sin \alpha$ で定義されるので、NAを増大するには屈折率nと開口半角 $\alpha$ を大きくすればよい。本発明では原盤の表面20と集光レンズ17との間に液体200（n > 1）が充満されているので、空気（n = 1）が原盤表面と集光レンズ間に介在する場合、すなわち、従来の原

盛電光装置の聚光レンズよりもNAを増大することができる。換言すれば、本発明の原盤電光装置では、聚光レンズ17を液漫レンズとして駆使させることができ。液体200は、NAを大きくするために、屈折率の大きな液体が好ましいが、レンズ17の収差の防止する観点から原盤の表面20と聚光レンズ17との間隔を微調整する場合には、聚光レンズ17の屈折率に近い屈折率を有する液体、例えば、セダ-油を用いるのが好ましい。しかしながら、液体200は、原盤のフォトレジスト膜20と接触することになるので、フォトレジストを閑食させず且つ後処理が容易であるという観点から水が好ましい。

〔0012〕本発明の原型露光装置は、さらに、現像液を原型上に供給するための手段を有することができる。原型露光装置に現像液供給手段を接着することにより露光後のプロセスに使用されていた現像装置が不要となり、露光・現像プロセスを簡略化することが可能になる。

〔0013〕上記現像液を原盤上に供給するための手段は、上記光学系子と原盤との間に介在させる液体または現像液を原盤上に吐出するためのノズルと、該ノズルに上記液体または現像液を供給するための供給装置と、上記ノズルへの上記液体または現像液の供給を切り換えるための切り換え装置とから構成することができる。本発明の原盤露光装置の具体例では、集光レンズと原盤との間に液体を介在させるために原盤上に液体を吐出するためのノズルとノズルに液体を供給するための供給装置を用いているので、供給液を現像液と露光用の液体とで切り換えることができる切り換え装置、例えば、電磁弁を装着すれば、かかるノズル及び液体供給装置を現像液供給用としても用いることができ、一層簡単な構造で現像液供給装置を原盤露光装置に組み込むことができる。

【0014】本発明の原盤露光装置は、さらに、露光及び現像された原盤のピットや溝の幅や歪さ等を検査するための検査装置を備えることができる。これにより、原盤露光装置により露光・現像・検査が一つの装置で可能となり、設備コストの削減及びスタンバ製造までのプロセスを簡略化することができる。従来の検査装置は光ヘッドを備え、光ヘッドからの検査光を走査して現像露光されたピットや溝幅を検査していたので、原盤露光装置の集光レンズを含む光ヘッドを検査用の光ヘッドとして使用することが可能となり、装置の簡略化及び小型化が可能となる。

【0015】本発明の第2の壁様に従えば、フォトレジストを塗布した記録媒体製造用原盤にレーザ光を聚焦して照射することによりフォトレジストを所望のパターンに感光する原盤露光方法において、上記レーザ光を聚焦するための光学系と原盤との間に液体を介在せながら原盤露光を行うことを特徴とする原盤露光方法が構成される。

[0016] 本発明の原盤露光方法に従えば、レーザ光を集光するための光学素子と原盤との間に液体を介在させながら原盤露光を行うために、光学素子を液浸レンズとして観察させて光ヘッドの露光解像力を向上させることができる。また、露光中に原盤上に付着した塵等を液体を洗浄することにより除去することができる。

[0017]

[発明の実施の形態] 以下、本発明の固体イマージョンレンズを用いた原盤露光装置の実施の形態及び実施例を図面を参照しながら説明する。

[0018] [第1実施例] 本発明に従う原盤露光装置の第1実施例を図1により説明する。図1は、原盤露光装置100の構成概略を示す。原盤露光装置100は、主に、露光用のレーザ光を出射するレーザ光源1、原盤19への照射タイミング及び照射位置をそれぞれ調整する音響光学(AO)変調器7及び音響光学(AO)偏光器9、露光用光ヘッド27、原盤19を回転するターンテーブル21、原盤19上に水を吐出するノズル210及び水/現像液供給装置220、照射されたスポットを観測するための撮像管24及びディスプレイ26並びに光路を調整するためのビームスプリッタ3、ミラー11、ハーフミラー13、レンズ6等の種々の光学素子から構成されている。

[0019] レーザ光源1から出射されたレーザ光束2はビームスプリッタ3により第1の光束4と第2の光束5に分けられる。第1の光束4は、一対のレンズ6で挟まれたAO変調器7に入射して、記録すべき信号のタイミングに応じたパルス光に変調される。AO変調器7で変調されたパルス光はミラー8で反射された後、AO偏光器9に入射して原盤19の所定の半径方向位置を照射するように偏光される。次いで、偏光された光は、偏光ミラー10及びミラー11を経て光ヘッド27に入射する。光ヘッド27には後述するリレーレンズ15及び集光レンズ17が装着されており、それらのレンズによりレーザ光は原盤19の表面の所定位置に集光される。原盤19上には予め入射光に対して屈光性のフィトレジスト20が塗布されている。一方、第2の光束5はEO変調器12に入射する。AO変調器7の代わりにEO変調器12により照射タイミング及び露光量を変調してもよい。EO変調器12を通過した光はハーフミラー13で反射され、又/又位相板14を通過した後、偏光ミラー10、ミラー11を経て光ヘッド27に到達する。

[0020] ノズル210はターンテーブル21の上方で且つ原盤19の中心近傍に配置されており、原盤19に向かって水200を吐出する。ターンテーブル21により原盤19が回転されるとその遠心力で水200は原盤19の外周に広がり、原盤のフィトレジスト20を覆う水膜を形成する。原盤19の外周に向かって流动した水200は集光レンズ17と原盤のフィトレジスト表面20との間を充満するため、集光レンズ17は液浸レ

ンズとして観察する。

[0021] 光ヘッド27から原盤19上のフィトレジスト20に照射された光は、前記式(1)及び液浸レンズの原理により空気中の理論的な最小スポット径よりも小さなスポットを形成してフィトレジスト20を露光させる。このため、従来の原盤露光装置よりも露光解像力が向上し、一層微細なピット及び素内蔵のパターンを高精度で露光することができる。光ヘッド27の構造の詳細については後述する。

[0022] 原盤19のフィトレジスト20の表面から反射された光は、集光レンズ17及びリレーレンズ15を透過して平行光となり、ミラー11、偏光ミラー10、ハーフミラー13を経てレンズ22により撮像管24上に集光される。撮像管24のディスプレイ26に表示されたスポット像26a、26bを観察することにより、集光レンズ17によって形成されるスポット形状を確認することができる。

[0023] レーザ光源1、AO変調器7、EO変調器12、ターンテーブル21等の動作は、図示しない制御部(図3及び図4参照)により一括して監視される。制御部にはプリフォーマット信号が入力され、それに応じてAO変調器7等の発光同期等が調整される。

[0024] 次に、原盤露光装置100の光ヘッド27の構造の詳細を図2及び図3を用いて説明する。図2は、集光レンズ17を弹性部材18を介して支持する光ヘッド27を下方から見た斜視図を示し、図3は光ヘッド27の拡大断面図を示す。なお、図3には、光ヘッド27の構造を分かり易くするために、ノズル210から吐出された水200の図示は省略してある。

[0025] 図2に示すように光ヘッド27は、集光レンズ17と、集光レンズ17を保持する集光レンズホルダ16aと、光ヘッドベース部28とを備え、集光レンズホルダ16aはベース部28の底面に固定された4本の支持部材29及びそれに接続された弹性部材18a、例えば板バネにより支持されている。この支持部材により、集光レンズホルダ16aは、原盤平面と平行な方向(図中X、Y方向)に拘束され、集光レンズ17の光軸方向(図中Z方向)に可動である。

[0026] 図3に示すように、集光レンズホルダ16aはその上部にビエゾ素子33を介してリレーレンズ15を支持するリレーレンズホルダ32を備える。ここで、ビエゾ素子33は集光レンズ17に対するリレーレンズ15の光軸方向位置を変更してリレーレンズ15の焦点位置を微調整する。

[0027] リレーレンズホルダ32は弹性部材18bを介してベース部28の支持部材29と連結されている。リレーレンズホルダ32上には、ボイスコイル型アクチュエータ140が構成するボビン34aが固定されており、アクチュエータ140の他の構成要素であるコイル34b、永久磁石35b、ヨーク36c、36dは

って原盤19との間隔が広くなるような盤面を形成している。集光レンズホルダ16bの内部には、外部から集光レンズ17に通じる空洞(光路)16f、16gが集光レンズ17の光軸を挟んで対称に形成されおり、一方の光路16fの開口部(光入射口)には光ファイバ40が嵌着され、他方の光路16gの開口部(光出射口)には、スリット41a及び検出部41bを備えたレンズ位置検出器41が嵌着されている。レンズ位置検出器41の検出部41bは前述のボイスコイルモータ140を制御する制御部88に接続されている。すなわち、実施例1の原盤露光装置では、ボイスコイルモータ140の制御はディスプレイ26による観察結果に基づいて行っていたが、この実施例ではレンズ位置検出器41からの検出信号に基づいて行う。

【0036】光ファイバ40から射出された光は空洞(光路)16fを通って集光レンズ17に入射した後、原盤19により反射されて再び集光レンズ17及び空洞(光路)16gを通ってレンズ位置検出器41に入射する。レンズ位置検出器41は、検出部41aと41bに分割されており、集光レンズ17の端面17cと原盤表面20との間隔が予め定めた適正値のとき、原盤からの反射光の中心がレンズ位置検出器41の検出部41aと41bの中間に配置するように設計されている。すなわち、このとき検出部41aと41bの前記反射光の光量が等しくなる。それゆえ、露光中、すなわち、ノズル210から水が吐出されて原盤表面のフォトレジスト20上を水が流動しているときに、集光レンズ17の端面17cと原盤のフォトレジスト20との間隔が適正な間隔になければ、検出部41aと41bから出てくる反射光検出力のバランスがくずれ、制御部ではこれに応じてボイスコイル型アクチュエータ140を駆動し集光レンズ17と原盤19との間隔が適正な値に修正されるようになる。また、水などの液体を集光レンズ17とフォトレジスト表面20との間に充満させた場合、フォトレジストと前記液体との屈折率が近似していれば、光ファイバ40から出た光がフォトレジスト表面20で反射される強度が小さくなり位置光検出部で検出される光量が減り、サーボが不安定になることがある。このような場合には、フォトレジストと原盤の間にアルミ等の反射膜を形成して反射光量を増すこともできる。

【0037】図5に示した原盤露光装置は、レンズ位置検出器41を備えるので集光レンズ17と原盤との間隔が常に適正な値になるように制御部88を通じて自動的に調整される。従って、露光中に原盤表面に供給された水の流量の変動等により集光レンズホルダ16bの上下方向の振れが生じた場合でも、振れを許めて集光レンズ17と原盤との間隔を適正な値に収束することができる。

【0038】以上、本発明を実施例により説明してきたが、本発明は特許請求の範囲に記載した範囲で実施例の

種々の変形及び改良を含むことができる。上記例では、原盤中央近傍に水/現像液が吐出されるようにノズルを配置したが、ノズルの位置は原盤の回転によって原盤と集光レンズとの間隙に水を充満させることができる限り任意の位置に配置することができる。例えば、原盤の半径方向において集光レンズと同一位置であり且つ原盤の回転方向前後にノズルを配置することができる。またノズルからの液体の吐出方向はノズルの向きを変更することによって任意の方向に調整することができる。

【0039】上記実施例ではノズルを用いて水を原盤上に吐出させる構成としたが、原盤外周に沿って盤面を絞ることによって原盤を底部とする容器を形成し、容器内に一定量の水を蓄えることによって原盤と集光レンズとの間隙に水を充満させることもできる。このようにすれば、ノズルから吐出する水の量を低減し、あるいは、露光前にのみノズルから水を容器内に充満させ、水の運動による集光レンズホルダの振れを抑制することができる。また、ノズル自体を省略して、上記のような容器構造だけを採用してもよい。すなわち、原盤と集光レンズとの間隙に水を介在させることができるようにすれば、任意の方法を用いることができる。

【0040】また、上記原盤露光装置は、光ヘッド部を現像処理時に原盤から退避させることができるような退避構造あるいは光ヘッド部に現像液が付着することを防止するための光ヘッドカバーを設けることができる。かかる退避機構または光ヘッドカバーを設けることによって光ヘッド部をアルカリ液である現像液から保護し、レンズ及びレンズホルダの腐食を防止することができる。

【0041】本発明の原盤露光装置は、コンパクトディスク、CD-ROM、デジタルビデオディスク等の再生専用の光記録媒体、CD-Rのような記録型記録媒体、光追跡ディスクのような交換型光記録媒体のみならずハードディスク等に使用されるエンボスピットタイプの追跡記録媒体を製造するために使用することができる。

【0042】

【発明の効果】本発明の原盤露光装置は、集光レンズと原盤との間に液体を介在させることによって集光レンズは液浸レンズとして機能することができるため、露光解析力を一層向上することができ、それによって低めて微小なピット、例えば、0.1~2μm以下のピットが形成される高密度記録媒体用の原盤を製造することも可能になる。

【0043】また、本発明の原盤露光装置は、現像液供給手段を有するため露光後のプロセスに従来使用されていた現像装置が不要となり、露光・現像プロセスを簡略化することができる。特に、現像液供給手段を、上記光学系と原盤との間に介在させる液体または現像液を原盤上に吐出するためのノズルと該ノズルに該液体または現像液を供給するための供給装置と上記ノズルへの該液体または現像液の供給を切り換えるための切り換え

特開平10-255319

(7)

12

11

装置とから構成することにより、ノズルから現像液と露光用の液体とを切り換えて吐出することができるため、一層簡単な構造で現像機能を原盤露光装置に組み込むことができる。

【0044】本発明の原盤露光装置は、さらに、露光及び現像された原盤のピットや溝の幅や深さ等を検査するための検査装置を備えることにより、原盤露光装置により露光・現像・検査が一つの装置で可能となり、設備コストの削減及びスタンダード化までのプロセスの簡略化を実現することができる。

【0045】本発明の原盤露光方法に従えば、レーザ光を露光するための光学系と原盤との間に液体を介在させながら原盤露光を行うために、光学系を液透レンズとして操作させることができるとともに露光中に原盤上に付着した塵等を流動除去することができる。このため光ヘッドの露光解像力及び露光精度を向上させることができになる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に従う原盤露光装置の全体構成を説明する概念図である。

【図2】図1に示した本発明に従う原盤露光装置の光ヘッドの第1実施例を下方から見た斜視図である。

【図3】図1に示した本発明に従う原盤露光装置の光ヘッドの第1実施例を示す断面図である。

【図4】本発明の第1実施例及び第2実施例に従う原盤\*

\*露光装置のノズル及び水/現像液供給装置の構造を説明する概念図である。

【図5】本発明の第2の実施例に従う原盤露光装置の光ヘッドの断面図である。

【図6】本発明の原盤露光装置の集光レンズが液透レンズとして操作することを説明する図である。

【符号の説明】

3 ビームスプリッタ

7 AO変調器

9 AO偏向器

16a, b 集光レンズホルダ

17 集光レンズ

18 弹性部材

20 フォトレジスト

27 光ヘッド

28 光ヘッドベース部

29 支持部材

82 現像液タンク

84 水タンク

92 空素ポンプ

100 原盤露光装置

130 ポイスコイル型アクチュエータ

200 水

210 水/現像液吐出ノズル

10

20

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

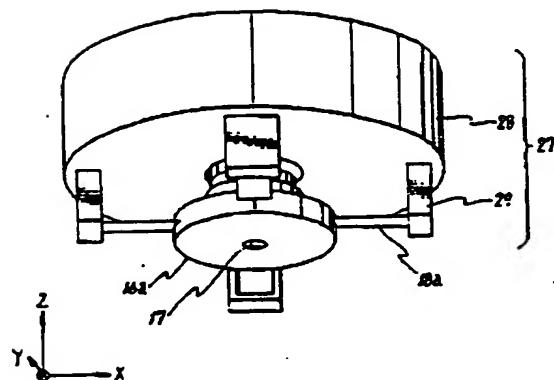
266

267

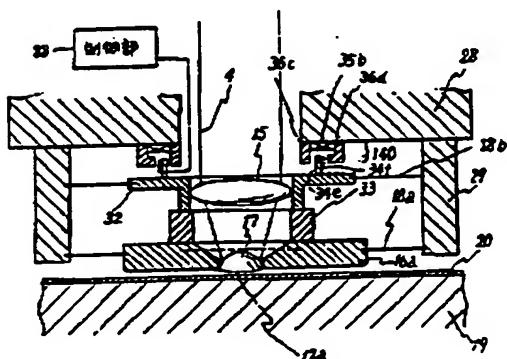
(8)

特陶平10-255319

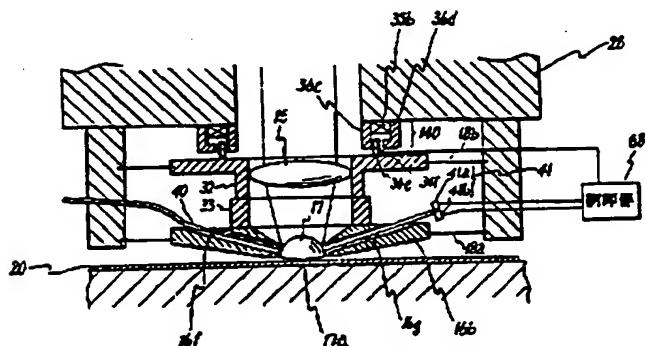
[图2]



[图3]



[5]



**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

**BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.